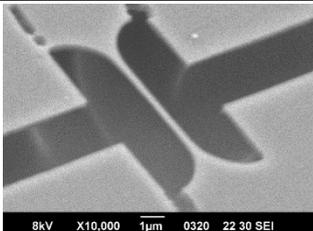
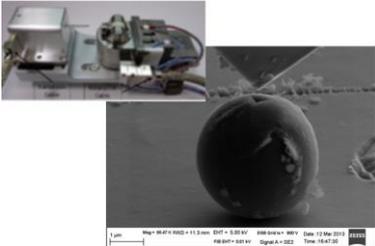


(様式 1)

1. 研究者	土屋智由
2. 研究者 DB 等	<a href="http://researchmap.jp/read0192569">http://researchmap.jp/read0192569</a>
3. 所属	京都大学 大学院/工学研究科/マイクロエンジニアリング専攻
4. 研究テーマ	ナノテクノロジーハブ拠点を活用したナノ材料評価のための集積化マイクロシステム
5. 利用可能な施設・装置等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>ナノハブ・クリーンルーム      試作した Si ナノワイヤ</p> <p>【主なプロセス装置】 高精細 EB 描画装置、電子サイクロトロン共鳴 (ECR) プラズマエッチング装置、磁気中性線放電プラズマ (NLD) エッチング装置 走査電子顕微鏡付集束イオンビーム加工装置 他</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>高精細 EB 描画装置      FIB-SEM</p> <p>【主な分析装置】 高精細電界放出形走査電子顕微鏡，分析走査電子顕微鏡，ナノインデント，SEM 中ピコインデント，X 線回折装置，原子間力顕微鏡 他</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>SEM 中ピコインデント      高速液中原子間力顕微鏡</p>
6. 研究室等 HP	<a href="http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/member/tsuchiya.html">http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/member/tsuchiya.html</a>
7. E-MAIL	tutti@me.kyoto-u.ac.jp
8. TEL	075-383-3691
9. 特記事項	京大ナノハブ拠点に設置されている高精細電子線描画装置をはじめとするナノ加工装置，ピコインデントを一体化した FIB-FESEM 複合機，各種走査型プローブ顕微鏡などの加工，分析装置を活用して、ナノ材料評価，ナノ・マイクロ集積化システム創製の研究を推進。